

半导体微纳光刻实验室 真空镀膜平台 宁夏回族自治区真空镀膜

产品名称	半导体微纳光刻实验室 真空镀膜平台 宁夏回族自治区真空镀膜
公司名称	广东省科学院半导体研究所
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区长兴路363号
联系电话	15018420573 15018420573

产品详情

低压气相沉积真空镀膜加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚焦半导体产业发展的应用技术研究，宁夏回族自治区真空镀膜，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社会发展的实际需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

真空镀膜的物理过程：PVD（物理的气相沉积技术）的基本原理可分为三个工艺步骤：

（1）镀料的气化：即镀料的蒸发、升华或被溅射从而形成气化源

（2）镀料粒子（（原子、分子或离子）的迁移：由气化源供出原子、分子或离子经过碰撞，产生多种反应。

（3）镀料粒子在基片表面的沉积。真空镀膜的工艺流程：真空镀膜的工艺流程一般依次为：前处理及化学清洗（表面打磨抛光喷砂，除锈除油去氧化层） 工件在真空中烘烤加热 离子辉光清洗 金属离子轰击 镀金属过渡层 镀膜（通入反应气体） 后处理（炉内钝化或出炉后钝化去应力或防止变色，过UV做防指膜处理等）。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

低压气相沉积真空镀膜加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚焦半导体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社会发展的实际需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，真空镀膜公司，以及行业应用技术开发。

钝化接触在两个方面上优于其他传统电池结构：

(1) 金属 / 半导体界面的复合通过晶硅和金属接触之间的钝化层而减少；

(2) 多子可以由隧穿效应移动到金属接触，但少子因为载流子选择性不能从晶硅移动到金属接触。这种钝化接触可用本征非晶硅或者超薄氧化硅作为钝化层。基于非晶硅的钝化接触便是异质结电池结构或者 HIT；基于SiO₂的钝化接触和多晶硅的叠加结构便是TOPCon技术。因为异质结结构目前工艺过程中有温度限制，所以poly - Si / SiO_x代替了非晶硅吸引到了众多研究者和企业的关注。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

低压气相沉积真空镀膜加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚焦半导体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社会发展的实际需要，真空镀膜服务，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

PECVD的维护保养：要正确规范地使用该设备，除了使用前进行必要的调试、使用过程中的正确操作之外，还需要对该设备定期进行保养及其维修，一般分为以下几个方面：1.保持真空度。工艺完成后，不继续做工艺时，真空镀膜平台，必须保持工艺管内为真空状态，每天做工艺时可查看各真空压力表读数，以便确定工艺管密封是否良好。2.保护气路。在做完工艺后，必须按说明书要求去操作。当环境温度较高时，产生的反应物会堵塞质量流量计，所以千万不要让工艺气体留在管路中。3.保护罗茨泵机。为了保护罗茨泵机组的寿命，要经常更换机械泵油，只要油泵观察窗发现油黑了就必须更换。设备用在生产线上一般5天必须更换一次油(干泵机组例外)。4.定期进行酸洗。为了良好的工艺、优良的沉积膜，工艺管要定期进行酸洗，在生产线上至少一个月洗一次。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

半导体微纳光刻实验室-真空镀膜平台-宁夏回族自治真空镀膜由广东省科学院半导体研究所提供。广东省科学院半导体研究所是从事“深硅刻蚀,真空镀膜,磁控溅射,材料刻蚀,紫外光刻”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾经理。